

ロボット関連技術PRカード

1. 企業概要

会 社 名	アリオス株式会社			代表者名	鈴木 浩明		
				窓口担当	鈴木 浩明		
事業内容	真空機器、理化学機器の設計・製造・販売			U R L	https://www.arios.co.jp		
主要製品	プラズマ・ラジカル・イオン源、プラズマ処理装置、成膜装置、研究開発用実験装置						
所在地	〒196-0021 東京都昭島市武蔵野 3-2-20						
電話／FAX 番号	042-546-4811／042-546-4814			E-mail	info@arios.co.jp		
資本金(百万円)	15	設立年月	1972 年 8 月	売上(百万円)	673	従業員数	35

2. PR事項

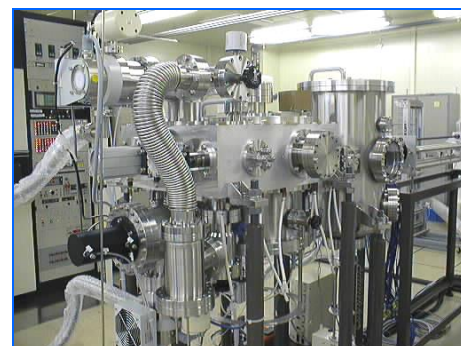
『 真空技術とプラズマ技術で社会に貢献する -ARIOS- 』



マイクロ波プラズマ・単結晶ダイヤモンド成長装置



MBE 装置



MOCVD 装置

先端技術の研究開発から生産装置開発までトータルサポート

□真空技術 -真空技術は多くの産業を支える基盤技術-

大気圧(10⁵Pa)から超高真空(10⁻⁹Pa)まで。MBE 装置、表面分析装置など超高真空装置の実績多数
真空部品から自動排気システムの設計・製作まで幅広く対応します。

□プラズマ技術 -多種多様なプラズマを目的に合わせて最適利用-

成膜、エッチング、表面改質、クリーニング、滅菌・殺菌…様々な用途に利用できるプラズマ
真空から液中まで、高電圧、高周波、マイクロ波など、用途に合わせたプラズマ生成技術でお応えします。

□メカトロニクス技術 -機械設計と制御技術の総合力-

自動化・安全対策設計は永年の実績があります。研究開発用装置から生産装置まで、お任せください。

3. 特記事項（得意技術以外に PR したい事項 例：特許情報、応用分野、表彰・認定）

- 2010 年 JST〈A-STEP (FS)シーズ顕在化タイプ〉に採択
「CVD 単結晶ダイヤモンド(111)自立基板の開発」
- 2013 年 JST〈A-STEP ハイリスク挑戦タイプ〉に採択
「半導体ダイヤモンドの開発」
- 2016 年 JST〈戦略的イノベーション創出プログラム〉に参画
「ポリマーナノ光ファイバーによる量子フォトニクス情報通信技術の開発」
- 2020 年 表面技術協会 技術賞受賞
「高密度プラズマによる高性能・高生産性を両立した DLC 成膜技術および装置の開発」
- 2021 年 日本質量分析学会 会誌賞受賞
- 真空・プラズマ技術及びメカトロニクス技術を活かしロボット関連事業の高度化をサポートします。